AN: PAT 1998-558218

TI: Piezoelectric actuator e.g. for control of motor vehicle injection valve has electrical terminals and mounted in prefabricated hollow moulding provided with passivation layer from which electrical terminals are brought out

PN: DE19715487-A1

PD: 22.10.1998

AB: The piezoelectric actuator (1) includes electrical terminals (3) for controlling the length of the actuator. The actuator is mounted in a prefabricated hollow moulding (4) which is at least partially moulded with a passivation layer. The electrical terminals (3) are brought out of the passivation layer and the hollow moulding. At least the top face of the actuator juts out over the hollow moulding, with the part of the actuator sticking out of the hollow moulding at least provided laterally with a passivation layer (8).; Provides costeffective, and easy to fabricate actuator.

PA: (SIEI) SIEMENS AG;

IN: FITZNER J; HAKAN Y; HEKELE W; KIRCHWEGER K; LEWENTZ G; RINK
J; SCHUH C; YALCIN H;

FA: DE19715487-A1 22.10.1998; DE19715487-C2 13.06.2002; WO9847188-A2 22.10.1998; EP976166-A2 02.02.2000;

CO: AT; BE; CH; CY; CZ; DE; DK; EP; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; JP; LU; MC; NL; PT; SE; US; WO;

DN: CZ; JP; US;

DR: AT; BE; CH; CY; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LU; MC; NL; PT; SE;

IC: H01L-041/053; H01L-041/083; H01L-041/09; H02N-002/02;

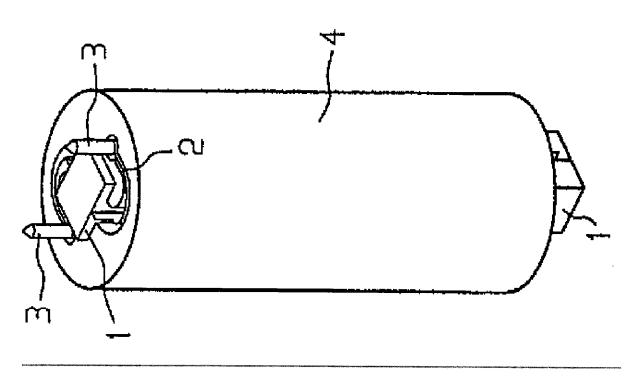
MC: V06-M06D; V06-U03; X22-A02A;

DC: V06; X22;

FN: 1998558218.gif

PR: DE1015487 14.04.1997;

FP: 22.10.1998 UP: 25.06.2002



			1
			\$

2004 POOZ81

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/47188 H01L 41/083 **A2** (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 22. Oktober 1998 (22.10.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/01021

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. April 1998 (08.04.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 15 487.5

14. April 1997 (14.04.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FITZNER, Johannes [DE/DE]; Mittelweg 3D, D-93170 Bernhardswald (DE). RINK, Jürgen [DE/DE]; Lindenstrasse 16, D-92442 Wackersdorf (DE). KIRCHWEGER, Karl [AT/DE]; Aussiger Strasse 6A, D-93057 Regensburg (DE). LEWENTZ, Günter [DE/DE]; Lärchenweg 5, D-93055 Regensburg (DE). YALCIN, Hakan [TR/DE]; An der Schergenbreite 26, D-93059 Regensburg (DE). SCHUH, Carsten [DE/DE]; Brunnenstrasse 73, D-85598 Baldham (DE). HEKELE, Wilhelm [DE/DE]; Gartenstrasse 2, D-83125 Eggstätt

MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(81) Bestimmungsstaaten: CZ, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

(54) Title: PIEZOELECTRIC ACTUATOR WITH A HOLLOW PROFILE

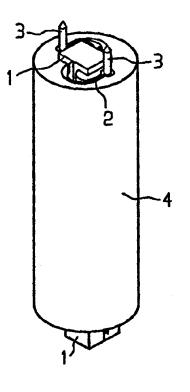
(54) Bezeichnung: PIEZOELEKTRISCHER AKTOR MIT EINEM HOHLPROFIL

(57) Abstract

In a simple manufacturing process, the piezoelectric actuator is inserted into a pre-fabricated hollow profile which is then sealed with a passivating layer. The hollow profile is configured in such a way that the contact pins, which are connected to the piezoelectric actuator by means of contact lugs, are arranged in a precisely defined position.

(57) Zusammenfassung

Für einen einfachen Fertigungsprozess wird der piezoelektrische Aktor in ein vorgefertigtes Hohlprofil eingebracht und das Hohlprofil mit einer Passivierungsschicht ausgegossen. Das Hohlprofil ist derart ausgebildet, daß Kontaktstifte, die über Kontaktfahnen mit dem piezoelektrischen Aktor verbunden sind, in einer genau definierten Lage angeordnet sind.



BNSDOCID: <WO_____9847188A2_I_>

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU Australien	GA	Gabun	$\mathbf{L}\mathbf{V}$	Lettland	SZ	Swasiland
AZ Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA Bosnien-Herzeg	owina GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF Zentralafrikanis	he Republik JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	$\mathbf{z}\mathbf{w}$	Zimbabwe
CM Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ Tschechische R	publik LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

Piezoelektrischer Aktor mit einem Hohlprofil

Die Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Aktor gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Piezoelektrische Aktoren werden beispielsweise in der Kraftfahrzeugtechnik zur Ansteuerung von Einspritzventilen verwendet.

Die Aufgabe der Erfindung beruht darin, einen kostengünstigen und einfach zu fertigenden piezoelektrischen Aktor bereit zu stellen.

15

10

Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung beruht darin, daß der Aktor kostengünstig hergestellt wird, indem der Aktor in ein vorgefertigtes Hohlprofil eingebettet

wird. Dadurch entfällt ein Entformungsprozess, der bei einer Umspritzung des piezoelektrischen Aktors notwendig ist.

Weitere vorteilhafte Ausbildungen und Verbesserungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

25

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren näher erläutert; es zeigen:

- Figur 1 einen piezoelektrischen Aktor,
- 30 Figur 2 ein Hohlprofil,
 - Figur 3 ein Hohlprofil mit einem piezoelektrischen Aktor,
 - Figur 4 einen passivierten piezoelektrischen Aktor,
 - Figur 5 einen piezoelektrischen Aktor mit einem angespritzten Steckergehäuse und

Figur 6 einen piezoelektrischen Aktor mit einem aufgeschobenen Kontaktstecker.

Figur 1 zeigt einen piezoelektrischen Aktor 1, der aus zwei

5 Stapeln alternierender Elektroden- und Keramikschichten 1 besteht. Die Elektrodenschichten sind mit zwei seitlich an jedem Stapel angebrachten, streifenförmigen Metallisierungen versehen, die jeweils mit einer elektrisch leitenden Kontaktfahne 2 verbunden sind. Jede Kontaktfahne 2 ist an einem Kontaktstift 3 angeschlossen, die parallel zur Längsrichtung der zwei Stapel 1 angeordnet sind und den oberen Stapel 1 in Längsrichtung überragen.

Figur 2 zeigt ein Hohlprofil 4, das eine zylindrische Außen15 form aufweist, die beispielsweise nach dem Stranggußverfahren, dem Spritzgußverfahren oder nach dem Extrudierverfahren
als Kunststoffhülse hergestellt wurde.

Die Kontaktstifte 3 sind als starre Stifte ausgebildet und 20 mittels Widerstands-, Laserschweißen oder Laserlöten mit der Kontaktfahne 2 verbunden. Das Hohlprofil 4 ist geringfügig kürzer als der Aktor 1 mit den zwei Stapeln.

Figur 2b zeigt schematisch die innere Kontur des Hohlprofils,

die eine zentrale, im wesentlichen rechteckige Ausnehmung 5
aufweist, von der an zwei gegenüberliegenden Seiten zwei
Schlitze 6 ausgehen, die jeweils in eine Stiftausnehmung 7
münden. Die Schlitze 6 sind vorzugsweise in einem vorgegebenen Radius gekrümmt ausgebildet, wobei der obere Schlitz 6 in
Richtung auf die linke Seitenfläche der zentralen Ausnehmung
5 und der untere Schlitz 6 in Richtung auf die rechte Seitenfläche der Ausnehmung 5 geführt ist. Die Schlitze 6 verjüngen sich ausgehend von der zentralen Ausnehmung 5 in Richtung auf die Stiftausnehmung 7. Die leicht gekrümmte Ausführung der

Schlitze 6 ermöglicht ein einfaches Einführen der Kontaktfah-

nen 2 und der Kontaktstifte 3 in das Hohlprofil 4. Anstelle der in Figur 2 dargestellten Kontur des Hohlprofils sind auch andere Hohlprofile möglich, wobei im einfachsten Fall eine einzige zentrale Ausnehmung zur Aufnahme des Piezoaktors mit seinen elektrischen Anschlüssen 2, 3 ausreicht.

Die Schlitze 6 weisen im Übergangsbereich 22 zu den Stiftausnehmungen 7 einen kleineren Durchmesser auf als der Durchmesser der Kontaktstifte 3 ist. Auf diese Weise wird verhindert, daß die Kontaktstifte 3 aus der Stiftausnehmung 7 herausrutschen. Dadurch werden die Kontaktstifte 3 in ihrer Position genau festgelegt und sind somit für einen automatisierten Fertigungsprozess gut geeignet. Das in Figur 2 dargestellte Hohlprofil hat weiterhin den Vorteil, daß es einfach und kostengünstig zu fertigen ist.

Figur 3 zeigt einen piezoelektrischen Aktor 1 mit Kontaktstiften 3 und Kontaktfahnen 2, der in das Hohlprofil 4 eingefügt ist. Der Aktor 1 befindet sich in der zentralen Ausnehmung 5, von der aus die Kontaktfahnen 2 über die Schlitze 6 zu den Stiftausnehmungen 7 geführt sind, in denen sich die Kontaktstifte 3 befinden. Vorzugsweise ragt der Aktor 1 über das obere und das untere Ende des Hohlprofils 4 heraus. Ebenso sind die Kontaktstifte 3 über das obere Ende des Hohlprofils 4 und über das obere Ende des Stapels 1 geführt. Die Kontaktstifte 3 sind in ihrer Position zueinander und zum Hohlprofil 4 genau festgelegt. Durch die leicht gekrümmte Ausführung der Schlitze 6 ist trotz der langen Kontaktfahnen 2 eine relativ kompakte Bauweise des Aktors 1 möglich.

30

10

15

Figur 4 zeigt einen Piezoaktor mit einem Hohlprofil 4 entsprechend Figur 3, bei dem der verbleibende Raum zwischen dem Aktor 1 und den Ausnehmungen 5,6,7 des Hohlprofils 4 mit einer Passivierungsschicht mindestens teilweise ausgefüllt ist, damit der Aktor 1 fest mit dem Hohlprofil 4 verbunden ist.

Die Passivierungsschicht im Innern des Hohlprofils 4 wird beispielsweise aus spritzfähigem Silikon hergestellt.

Zudem ist der über den oberen Rand des Hohlprofils 4 und über den unteren Rand des Hohlprofils 4 hinausragende Teil des Aktor 1 von einer elastischen Passivierung 8,15 mindestens seitlich umgossen, die beispielsweise aus streichfähigem Silikon, das nach der Verarbeitung aushärtet, hergestellt wird.

Die Oberseite der oberen Passivierungsschicht 8 und die Unterseite der unteren Passivierungsschicht 15 schließen mit dem oberen Ende und dem unteren Ende des oberen beziehungsweise des unteren Stapels 1 ab. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß der Aktor 1 an einem Gehäuse 13 oder an einem Stellglied direkt anliegt.

Vorzugsweise ist auch die Oberseite und die Unterseite des Aktors mit einer Passivierungsschicht vorgegebener Dicke abgedeckt, die als Dämpfungs- und Schutzpolster dient. Die Kontaktstifte 3 ragen über die obere Passivierungsschicht 8 hinaus.

Der in Figur 4 dargestellte piezoelektrische Aktor ist leicht zu handhaben, einfach zu Kontaktieren und für die weitere 25 Verarbeitung durch das umgebende, dichte Hohlprofil 4 und die Passivierungsschicht 8, 15 geschützt.

Eine bevorzugte weitere Bearbeitung des piezoelektrischen Aktors besteht darin, auf die Kontaktstifte 3 eine Kontaktplatte 10 aufzustecken, die in einem entsprechenden Abstand zwei durchgehende Kontaktlöcher 16 aufweist, in die die Kontaktstifte 3 eingesteckt werden, wie in Figur 6 dargestellt ist. Die Kontaktplatte 10 ist vorzugsweise aus einem isolierenden Kunststoff gebildet, wobei im Inneren der Kontaktplatte 10 ausgehend von den Kontaktlöchern 16 jeweils eine elektrische

Leitung 17 zu einem Anschlußstift 18 geführt ist, die aus der Kontaktplatte 10 herausragen.

Für eine weitere Verarbeitung wird der piezoelektrische Aktor

5 mit dem Hohlprofil 4 in ein Gehäuse 13 eingeschoben, wobei
das Gehäuse 13 in einer Deckplatte 19 elektrisch isolierte
Durchführungen 14 zum Durchführen der Kontaktstifte 3 aufweist, wie in Figur 5 dargestellt ist. Das Gehäuse 13 ist
beispielsweise aus Metall, insbesondere Stahl oder Aluminium

10 oder aus einer Keramik gefertigt. Die Durchführungen 14 sind
bei einem elektrisch leitenden Gehäuse 13 isoliert ausgebildet.

Auf die Kontaktstifte 3 wird, wie in Figur 6 dargestellt, die Kontaktplatte 10 aufgesteckt. Anschließend werden der obere Teil des Gehäuses 13, die Kontaktstifte 3 und die Kontaktplatte 10 mit einem Steckergehäuse 20 umspritzt. Das Steckergehäuse 20 ist derart ausgebildet, daß die Anschlußstifte 18 in eine Anschlußkammer 12 ragen und somit für eine Kontaktierung bereit stehen.

Figur 5 zeigt somit eine Baueinheit mit einem piezoelektrischen Aktor 1, mit Gehäuse 13 und mit einem Steckergehäuse 20, die fertig vormontiert ist und mit der Anschlußkammer 12 25 auf einem entsprechenden Injektor aufgeflanscht werden kann.

10

15

20

Patentansprüche

- Piezoelektrischer Aktor (1) mit elektrischen Anschlüssen
 (3) zum Steuern der Länge des Aktors (1), dadurch gekennzeichnet,
- daß der Aktor (1) in ein vorgefertigtes Hohlprofil (4) eingebracht ist, daß das Hohlprofil (4) mit einer Passivierungsschicht wenigstens teilweise ausgegossen ist, und daß die elektrischen Anschlüsse (3) aus der Passivierungsschicht und dem Hohlprofil (4) herausgeführt sind.
- 2. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die Oberseite des Aktors (1) über das Hohlprofil (4) hinausragt, und daß der aus dem Hohlprofil (4) herausragende Teil des Aktors (1) mindestens seitlich mit

einer Passivierungsschicht (8) umgossen ist.

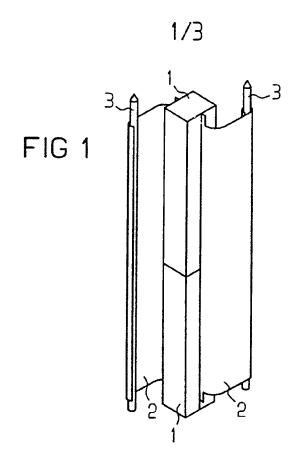
- 3. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrischen Anschlüsse in Form von Stiften (3) ausgebildet sind, die nahezu parallel zur Längsrichtung des Aktors (1) angeordnet sind, und daß die Stifte in Längsrichtung über den Aktor (1) auf einer Seite hinausragen.
- 4. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Hohlprofil (4) eine zentrale Ausnehmung (5)
 für die Aufnahme des Aktors (1) und zwei seitlich zur zentralen Ausnehmung (5) versetzte Stiftausnehmungen (7) aufweist,
 die über Schlitze (6) mit der zentralen Ausnehmung (5) verbunden sind.
 - 5. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Schlitze (6) im Übergang zu der Stiftausnehmung einen kleinere Breite aufweisen als die Stifte (3), damit die Stifte (3) in der Stiftausnehmung (7) festgehalten

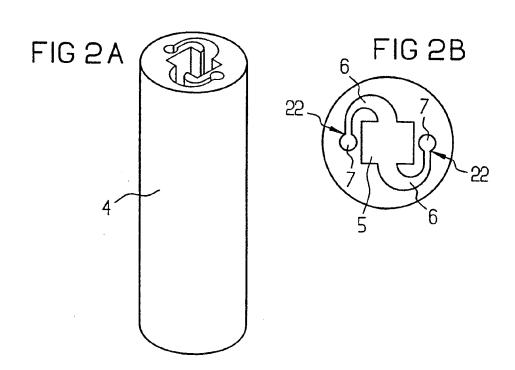
30 .

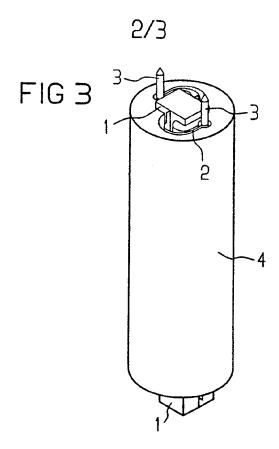
15

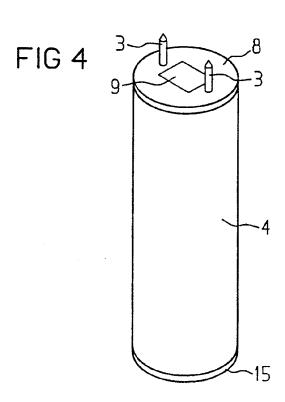
werden und somit einen definierten Abstand zueinander aufweisen.

- 6. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Hohlprofil (4) mindestens teilweise in ein Gehäuse (13) eingebracht ist, daß die Stifte (3) durch das Gehäuse (13) in ein an das Gehäuse (13) angespritztes Stekkergehäuse (11) geführt sind, daß die Stifte (3) mit einer Kontaktplatte (10) mit Steckerfahnen (18) angeschlossen sind, die in eine Anschlußkammer (12) ragen.
- 7. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Stifte (3) über Folien (2) an den Aktor
 (1) angeschlossen sind, und daß die Schlitze (6) senkrecht
 zur Längsrichtung des Aktors (1) gesehen in einer gekrümmten
 Bahn ausgebildet sind, in der die Folien (2) geführt sind.

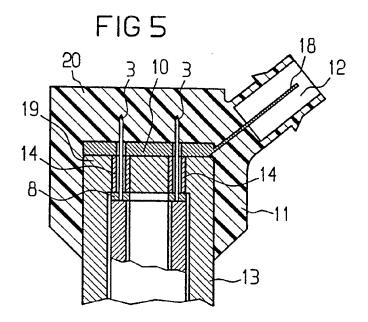


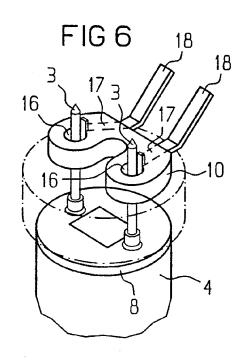






3/3





WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE-INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 41/083, 41/053

A3

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/47188

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

22. Oktober 1998 (22.10.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/01021

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. April 1998 (08.04.98)

(81) Bestimmungsstaaten: CZ, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

197 15 487.5

14. April 1997 (14.04.97)

DE

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2,

D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FITZNER, Johannes [DE/DE]; Mittelweg 3D, D-93170 Bernhardswald (DE). RINK, Jürgen [DE/DE]; Lindenstrasse 16, D-92442 Wackersdorf (DE). KIRCHWEGER, Karl [AT/DE]; Aussiger Strasse 6A, D-93057 Regensburg (DE). LEWENTZ, Günter [DE/DE]; Lärchenweg 5, D-93055 Regensburg (DE). YALCIN, Hakan [TR/DE]; An der Schergenbreite 26, D-93059 Regensburg (DE). SCHUH, Carsten [DE/DE]; Brunnenstrasse 73, D-85598 Baldham (DE). HEKELE, Wilhelm [DE/DE]; Gartenstrasse 2, D-83125 Eggstätt (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenbe-28. Januar 1999 (28.01.99)

(54) Title: PIEZOELECTRIC ACTUATOR WITH A HOLLOW PROFILE

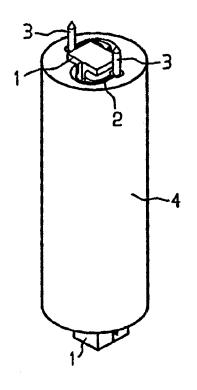
(54) Bezeichnung: PIEZOELEKTRISCHER AKTOR MIT EINEM HOHLPROFIL

(57) Abstract

In a simple manufacturing process, the piezoelectric actuator is inserted into a pre-fabricated hollow profile which is then sealed with a passivating layer. The hollow profile is configured in such a way that the contact pins, which are connected to the piezoelectric actuator by means of contact lugs, are arranged in a precisely defined position.

(57) Zusammenfassung

Für einen einfachen Fertigungsprozess wird der piezoelektrische Aktor in ein vorgefertigtes Hohlprofil eingebracht und das Hohlprofil mit einer Passivierungsschicht ausgegossen. Das Hohlprofil ist derart ausgebildet, daß Kontaktstifte, die über Kontaktfahnen mit dem piezoelektrischen Aktor verbunden sind, in einer genau definierten Lage angeordnet sind.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑÜ	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
-	Total 1	V TO	T 10	0.0	0:		

SG

Singapur

ΕE

Estland

LR

Liberia

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr 1al Application No PCT/DE 98/01021

		1	101752 307 01021	أخشعت سسا	
a. classi IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L41/083 H01L41/053		• .		
According to	o International Patent Classification(IPC) or to both national cla	ssification and IPC			
	SEARCHED				
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by class $H01L$	ification symbols)			
Documenta	tion searched other than minimumdocumentation to the extent	that such documents are inclu	ded in the fields searched		
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of da	ata base and, where practical,	search terms used)		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of ti	he relevant passages	Relevant to cta	im No.	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22 February 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OP- LTD), 27 October 1988 see abstract	TICAL CO	1		
A	EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTR 7 June 1989 see abstract; figure 3	IC CO)	1		
A	EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM 27 February 1991 see abstract	TEC AG)	1		
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family i	members are listed in annex.		
"A" docume consider filing of the control occume which citation other "P" docume of the control occume other "P" docume occume other "P" docume occume occumentation occumentation occumentation occumentation occurrence occurr	ategories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publicationdate of another on or other special reason (as specified) lent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	or priority date an cited to understan invention "X" document of partic cannot be conside involve an invention "Y" document of partic cannot be conside document is combinents, such combin the art.	plished after the international filing date and not in conflict with the application but do the principle or theory underlying the ular relevance; the claimed invention ered novel or cannot be considered to we step when the document is taken alone ular relevance; the claimed invention ered to involve an inventive step when the bind with one or more other such docubination being obvious to a person skilled or of the same patent family	3	
	actual completion of theinternational search		the international search report		
	.5 October 1998	21/10/1	.998 		
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Authorized officer			
	Fax: (+31-70) 340-3016	Pelsers, L			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter: nal Application No
PGT/DE 98/01021

	Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
EI	P 0319038	A	07-06-1989	JP JP DE DE	2125675 A 1146379 A 3850641 D 3850641 T	14-05-1990 08-06-1989 18-08-1994 27-10-1994	
El	P 0414138	A	27-02-1991	DE DE ES JP PT	39274C6 A 59007614 D 2063876 T 3089571 A 95020 A,B	21-02-1991 08-12-1994 16-01-1995 15-04-1991 30-04-1992	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

BNSDOCID: <WO_____9847188A3_I_>

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter: naies Aktenzeichen
PCT/DE 98/01021

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H01L41/083 H01L41/053 Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 H01L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiele fallen Während der internationalen Recherche konsultierte eiektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendste Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (0LYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 A EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 H01L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte eiektronische Datenbank (Name der Datenbank und evti. verwendate Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 A EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	
Fecherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) TPK 6 H01L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffantlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte eiektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG)	,
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte eiektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendste Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 1 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 17. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 A EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	
A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL COLTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 A EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	
A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 A EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	
vol. 013, no. 078 (E-718), 22. Februar 1989 & JP 63 260087 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. Oktober 1988 siehe Zusammenfassung A EP 0 319 038 A (NIPPON ELECTRIC CO) 7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	Nr.
7. Juni 1989 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 A EP 0 414 138 A (HOECHST CERAM TEC AG) 1	
27. Februar 1991 siehe Zusammenfassung	
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhatt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "S" Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldent, anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis de Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrunde Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachte werden, wenn die Veröffentlichung mie Veröffentlichung dieser Kategorie in Verbindung gebracht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 	er s der der Erfindung der auf te Erfindung et anderen
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 15. Oktober 1998 21/10/1998	
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016 Pelsers, L	

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentlamilie gehören

Intern ales Aktenzeichen
PCT/DE 98/01021

	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP	0319038	A	07-06-1989	JP JP DE DE	2125675 A 1146379 A 3850641 D 3850641 T	14-05-1990 08-06-1989 18-08-1994 27-10-1994	
EP	0414138	A	27-02-1991	DE DE ES JP PT	3927406 A 59007614 D 2063876 T 3089571 A 95020 A,B	21-02-1991 08-12-1994 16-01-1995 15-04-1991 30-04-1992	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)